



N₂対応リフローはんだ付け装置 RF-430series

RF-430 Model-1/IR	IR+自然対流方式
RF-430 Model-2/IRN ₂	IR+N ₂ 方式
RF-430 Model-3/HA	IR+ホットエア強制対流方式
RF-430 Model-4/HAN ₂	IR+N ₂ 強制対流方式

RF-430は遠赤外線と熱対流を基本加熱にした、窒素(N₂)対応の小型リフローはんだ付け装置です。卓上の小型リフロー装置ながら、N₂対応機種は約5000ppmの酸素濃度を実現しました。遠赤外線(IR)4ゾーン式なので安定した温度プロファイルが得られます。

特長

- 卓上型窒素(N₂)対応のリフローはんだ付け装置です。酸素濃度は約5000ppm(Model-2/Model-4)。
- 遠赤(IR)と熱対流の4ゾーン加熱です。素早い加熱で安定した温度プロファイルが得られます。
- 基本ModelからN₂対応機へ将来グレードアップができます(要メーカー工事)。

仕様

- ・加熱部 : 4ゾーン 幅300mm×長さ980mm 入口高さ50mm
- ヒーター : 石英管ヒーター IR(波長:2~10μm)
- 各ゾーン上部:1.2kW(200V) / 1.4kW(220V)
- 下部:0または0.9kW(200V) / 0または1.05kW(220V)
- 加熱方式 : Model-1/IR IR+自然対流方式
- Model-2/IRN₂ IR+N₂方式
- Model-3/HA IR+ホットエア強制対流方式
- Model-4/HAN₂ IR+N₂強制対流方式
- 温度制御 : Max300℃ P.I.D.温度調節器
- 各ゾーン共上部炉内雰囲気温度制御
- ・コンベア : 幅300mm SUSメッシュベルト。90~1400mm/min
- 方向 : R→L 又は L→R(指定)
- スピード調節: デジタル式スピード調節器
- ・冷却 : 出口側ファンによる強制空冷
- ・電源 : 単相200V 約6.7kW(220V 約7.8kW) 50/60Hz
- ・N₂供給量 : 約20~100ℓ/min (Model-2/4)
- ・安全装置 : 漏電/過電流ブレーカー。非常停止スイッチ。
- 警報出力(過温/低温/ヒーター断線)
- ・寸法・重量: (W)1600×(D)660×(H)560mm 約140kg(Model-1/2)
- (W)1600×(D)660×(H)600mm 約180kg(Model-3/4)

適合基板

- 寸法 : 15×15mm~300×300mm
- 板厚 : 0.1~2mm
- 高さ : Max50mm

用途

- ・H-ICやSMT基板のリフローはんだ付け。
- ・非洗浄タイプクリームはんだのリフローはんだ付け。(Model-2/4)
- ・熱硬化接着剤の乾燥。その他加熱作業。

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。